

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION
EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international



(43) Date de la publication internationale
6 janvier 2005 (06.01.2005)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2005/000759 A2

(51) Classification internationale des brevets⁷ : C03C 17/34

1, 52062 Aachen (DE). JANSEN, Manfred [DE/DE];
Wielandstrasse 35, 52511 Geilenkirchen (DE).

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2004/001652

(74) Mandataire : SAINT-GOBAIN RECHERCHE; 39,
quai Lucien Lefranc, F-93300 Aubervilliers (FR).

(22) Date de dépôt international : 28 juin 2004 (28.06.2004)

(81) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG,
MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH,
PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN,
TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
03/07847 27 juin 2003 (27.06.2003) FR

(71) Déposant (pour tous les États désignés sauf US) : SAINT-
GOBAIN GLASS FRANCE [FR/FR]; "Les Miroirs", 18,
avenue d'Alsace, F-92400 Courbevoie (FR).

(84) États désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasién (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI,
SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ,
GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : BAUBET,
Carole [FR/DE]; Boxgraben 24-26, 52064 Aachen
(DE). FISCHER, Klaus [DE/DE]; Adolf Kolping
Strasse 10, 52477 Alsdorf (DE). LOERGEN, Mar-
cus [DE/DE]; Bleibtreustrasse 16, 10623 Berlin (DE).
GIRON, Jean-Christophe [FR/DE]; Vaalser Strasse 136,
52074 Aachen (DE). NADAUD, Nicolas [FR/FR]; 63,
avenue Pasteur, F-94250 Gentilly (FR). MATTMAN, Eric
[FR/FR]; 20, rue Oudry, F-75013 Paris (FR). ROUSSEAU,
Jean-Paul [FR/FR]; 26, rue de l'Est, F-92100 Boulogne
(FR). HOFRICHTER, Alfred [DE/DE]; Rethelstrasse

Publiée :

— sans rapport de recherche internationale, sera republiée
dès réception de ce rapport

En ce qui concerne les codes à deux lettres et autres abrégia-
tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et
abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
la Gazette du PCT.

(54) Title: DIELECTRIC-LAYER-COATED SUBSTRATE AND INSTALLATION FOR PRODUCTION THEREOF

(54) Titre : SUBSTRAT REVETU D'UNE COUCHE DIELECTRIQUE ET PROCEDE ET INSTALLATION POUR SA FABRI-
CATION

(57) Abstract: The invention relates to a substrate (1), such as a glass substrate, which is coated with at least one thin dielectric layer. According to the invention, the dielectric layer is deposited by means of cathode sputtering which is, for example, assisted by a magnetic field and which is preferably reactive in the presence of oxygen and/or nitrogen, with exposure to at least one ion beam (3) from an ion source (4). The invention is characterised in that the dielectric layer which is exposed to the ion beam has a refractive index which can be adjusted on the basis of the parameters of the ion source, said ion source being a linear source.

(57) Abrégé : L'invention concerne un substrat (1) notamment verrier, revêtu d'au moins une couche mince diélectrique déposée par pulvérisation cathodique, notamment assistée par champ magnétique et de préférence réactive en présence d'oxygène et/ou d'azote, avec exposition à au moins un faisceau d'ions (3) issu d'une source ionique (4), caractérisé en ce que ladite couche diélectrique exposée au faisceau d'ions a un indice de réfraction susceptible d'être ajusté suivant les paramètres de la source ionique, ladite source ionique étant une source linéaire.

WO 2005/000759 A2